This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/JP99/06641

日本国特許庁 26.11.99 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

JU

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1998年11月30日

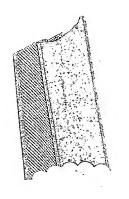
REC'D 28 JAN 2000

出 願 番 号 Application Number:

平成10年特許顯第339606号

出 額 人 Applicant (s):

セイコーエプソン株式会社

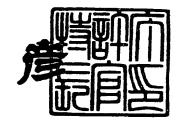


PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 1月 7日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近 藤 隆



【書類名】 特許願

【整理番号】 J0071071

【提出日】 平成10年11月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02F 1/133

【発明の名称】 液晶パネルおよび該液晶パネルを用いた投射型表示装置

【請求項の数】 15

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 井上 健

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 斉藤 広美

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代表者】 安川 英昭

【代理人】

【識別番号】 100093388

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

【連絡先】 0266-52-3139

【選任した代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要 【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶パネルおよび該液晶パネルを用いた投射型表示装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1及び第2基板間に液晶が挟持されてなり、前記第1基板に形成された複数の走査線と複数のデータ線と、前記各走査線とデータ線に接続されたスイッチング素子と前記スイッチング素子に接続された画素電極とからなる画素とを有し、

前記第1及び第2基板のうちの一方の基板には各画素に対向するように第1マイクロレンズが形成されてなり、前記第1マイクロレンズの光学的中心位置は、 該第1マイクロレンズに対向する画素の開口領域の中心位置に対して明視方向側 にずれていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項2】 前記第1及び第2基板の他方の基板には各画素に対向するように マイクロレンズが形成されてなることを特徴とする請求項又は1のいずれか一項 に記載の液晶パネル。

【請求項3】 前記第2マイクロレンズの光学的中心位置は、該第2マイクロレンズに対向する画素の開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする請求項2に記載の液晶パネル。

【請求項4】 第1及び第2基板間に液晶が挟持されてなり、前記第1基板に形成された複数の走査線と複数のデータ線と、前記各走査線とデータ線に接続されたスイッチング素子と前記スイッチング素子に接続された画素電極とからなる画素とを有し、前記第2基板には遮光膜が形成されてなる液晶パネルにおいて、

前記第1及び第2基板には画素毎に第1及び第2の開口領域が形成されている とともに、前記第1及び第2の開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成さ れた開口領域の中心位置は、光が出射される側の基板に形成された開口領域の中 心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項5】 前記第2基板には各画素毎に対向するようにマイクロレンズが形成されてなり、前記マイクロレンズの光学的中心位置は、前記第2基板の開口領域の中心位置にほぼ一致するように配置されてなることを特徴とする請求項4に記載の液晶パネル。

【請求項6】 前記第2基板には各画素毎に対向するようにマイクロレンズが形成されてなり、前記マイクロレンズの光学的中心位置は、該マイクロレンズが形成された基板の開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする請求項4に記載の液晶パネル。

【請求項7】 請求項1乃至請求項6のいずれか一項において、前記第1および第2基板では、隣接する前記画素電極の間に相当する領域と重なるように第1および第2の遮光膜がそれぞれマトリクス状に形成されていることにより、該第1および第2の遮光膜によって前記第1及び第2開口領域が前記画素毎にマトリクス状に区画形成されていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項8】 請求項7において、前記第1および第2の遮光膜のうち、光が入射する側の基板に形成された遮光膜が、光が出射する側の基板に形成されている開口領域に対して明視方向側と比較して逆明視方向側で幅広に重なっていることにより、前記第1および第2の開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成された開口領域の中心位置が、光が出射する側の基板に形成された開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項9】 請求項7において、前記第1および第2の遮光膜のうち、光が出射する側の基板に形成された遮光膜が、光が入射する側の基板に形成されている開口領域に対して逆明視方向側と比較して明視方向側で幅広に重なっていることにより、前記第1および第2の開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成された開口領域の中心位置が、光が出射する側の基板に形成された開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項10】 請求項1乃至9のいずれか一項において、光源からの光は、前記第2の基板に入射して前記第1基板から出射するように構成されていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項11】 請求項1乃至10のいずれか一項において、前記各画素では、前記画素スイッチング素子が前記画素電極に対して明視方向側に形成されていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項12】 請求項1乃至11のいずれか一項において、前記各画素では、 前記画素スイッチング素子に接続される走査線及び容量線が明視方向側に形成さ れていることを特徴とする液晶パネル。

【請求項13】 前記液晶パネルに入射される光の光軸が前記液晶パネルの法線 方向に対して明視方向側に傾いていることを特徴とする請求項1乃至12のいず れか一項に記載の液晶パネル。

【請求項14】 請求項1乃至13のいずれかに規定する液晶パネルを用いた投射型表示装置であって、光源と、該光源から出射された光を前記液晶パネルに導く集光系と、当該液晶パネルで光変調した光を拡大投射する拡大投射光学系とを有することを特徴とする投射型表示装置。

【請求項15】 前記液晶パネルの法線方向に対して光軸が明視方向側に傾いた 光が前記液晶パネルに入射されることを特徴とする請求項14に記載の投射型表 示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、一対の基板間に封入された液晶が当該基板間で捩じれ配向している液晶パネル、およびこの液晶液晶パネルをライトバルブとして用いた投射型表示装置に関するものである。さらに詳しくは、液晶パネルを用いた表示装置におけるコントラスト向上技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

一対の基板間に封入された液晶(TN液晶/ツイステッドネマティックモードの液晶)が当該基板間で捩じれ配向しているタイプの液晶パネルは、たとえば投射型表示装置に対してライトバルイブとして搭載される。この種の投射型表示装置では、例えば、一般に赤、青、緑の三原色の光を各液晶パネルを通してそれぞれの色毎に画像成分を形成し、これらの画像成分を合成して所望のカラー画像を作り出し、投射している。

[0003]

このような従来の液晶パネルの構成について図17を用いて説明する。

[0004]

図17は、従来の液晶パネルに用いたアクティブマトリクス基板、対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を模式的に拡大して示す断面図である。

[0005]

図17に示すように、液晶パネル1では、透明な画素電極8、配向膜46、画 素スイッチング用の薄膜トランジスタ(以下、TFTと称す)(図示せず)、デ - タ線(図示せず)、走査線91および容量線92などが形成されたアクティブ マトリクス基板20と、透明な対向電極32および配向膜47が形成された対向 基板30と、これらの基板間に封入、挟持されている液晶39とから概略構成さ れている。ここに封入される液晶39としては、配向膜46、47によって基板 間で90°に捩じれ配向したTN(ツイステッドネマティック)モードの液晶が 広く用いられている。このように構成した液晶パネル1では、アクティブマトリ クス基板20において、TFT10を介してデータ線90から画素電極8に印加 した画像信号によって、画素電極8と対向電極32との間において液晶39の配 向状態を制御することができる。それ故、透過型の液晶パネル1において、対向 基板30側から入射された光は、入射側偏光板(図示せず。)によって所定の直 線偏光光に揃えられた後、対向基板30の側から液晶39の層に入射し、ある領 域を透過する直線偏光光は透過偏光軸が捩じられてアクティブマトリクス基板2 0から出射される一方、他の領域を通過した直線偏光光は透過偏光軸が捩じられ ることなくアクティブマトリクス基板20の側から出射する。それ故、出射側偏 光板(図示せず。)を通過するのは、液晶39によって偏光軸が捩じられた方の 直線偏光光、あるいは液晶39によって偏光軸が捩じられることのなかった直線 偏光光のうちの一方である。よって、これらの偏光状態を画素毎に制御すること により所定の情報を表示することができる。

[0006]

ここで、対向基板30の側から入射した光がTFTのチャネル領域に入射、あるいは反射されるとこのような光は表示に寄与しないだけでなく、光電変換効果により光電流が発生し、TFTのトランジスタ特性が劣化する。このため、アクティブマトリクス基板20および対向基板30には、隣接する画素電極8の間の

領域に重なるように、クロムなどの金属材料や樹脂ブラックなどからなるブラックマトリクス、あるいはブラックマスクと称せられる第1の遮光膜6および第2の遮光膜7が形成されることがある。このように構成した場合に、液晶パネル1では、アクティブマトリクス基板20および対向基板30のいずれにおいても、第1の遮光膜6および第2の遮光膜7で区画された第1および第2の開口領域21、31のみを光が透過し、それ以外の領域では光が第1の遮光膜6および第2の遮光膜7で遮られるので、TFT10のチャネル領域に強い光が入射し、あるいは反射してくるのを防止することができる。このような構成の液晶パネル1においては、図17に示すように、アクティブマトリクス基板20の第1の遮光膜6と対向基板30の第2の遮光膜7とは、略重なる領域に形成される。このため、アクティブマトリクス基板20の第1の開口領域31と対向基板30の第2の開口領域21とは、それらの中心位置211、311が一致する。

[0007]

また、別の液晶パネルの従来例として図示を省略するが、対向基板30にマイクロレンズを形成し、液晶パネルに入射される光を集光することにより光の利用効率を高めることがある。このように対向基板30にマイクロレンズ(図示せず)を形成する際にも、マイクロレンズの光学的中心位置をアクティブマトリクス基板20と対向基板30の開口領域の中心位置に重ねるように形成することにより、表示に寄与する光量の減少を防止することができるので、信頼性が高く、且つ明るい表示を行うことのできる液晶パネル1を構成することができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

このように構成した液晶パネル1において、図18に液晶の配向状態を模式的に示すように、液晶39は、アクティブマトリクス基板20と対向基板30との間で、90°に捩じれ配向した状態にある。ここで、図18には各基板20、30の方向を表すために、時計における時刻に相当する数字を付してある。このような90°の捩じれをもたせるには、各基板20、30の表面に配向膜46、47となるポリイミド膜などを形成した後、矢印Aおよび矢印Bでそれぞれのラビング方向を示すように、一対の基板間で互いに直角をなす方向にそれぞれラビン

グ処理を施した後、基板20、30を貼り合わせ、その隙間に液晶39を充填する。その結果、液晶39は、配向膜46、47へのラビング方向に長軸方向を向けて配向し、一対の基板20、30間において液晶39の長軸方向は90° 捩じれる。

[0009]

このようにして捩じれ配向させた液晶39を用いた液晶パネル1では、基板20、30間の中央に位置する液晶39の配向状態(長軸方向および長軸の傾き)によりコントラスト特性が方向性を示す。すなわち、図18に示すように液晶39を配向させたときは、図19(A)に示すように、この液晶パネル1の3時-9時方向におけるコントラスト特性は、6時-12時を中心に左右対称の特性を示す。これに対して、図19(B)に示すように、この液晶パネル1の6時-12時方向におけるコントラスト特性は、6時の方向においてコントラストが高い一方、それから外れると大幅に低下する。たとえば、12時の方向では著しくコントラストが低下する。このようなとき、6時の方向を明視方向といい、それとは反対の方向を逆明視方向という。

[0010]

従って、図20に示すように、液晶パネル1に対しては明視方向からの光のみが入射し、逆明視方向からの光が入射しないようにすれば、コントラストの高い表示を行うことができるが、例えば投射型表示装置において光源から出射された光を導光系において平行光束にしているものの、それでも液晶パネル1に対しては、法線方向に対して逆明視方向に斜めに傾いた方向から光が入射するのを防止することができない。その結果、従来の液晶パネル1では、図17にそれぞれ示すように、対向基板30の側から入射した光のうち、逆明視方向に傾いた方向から入射した光も、明視方向に傾いた方向から入射した光と同様に、液晶39の層を透過した後、アクティブマトリクス基板20の第1の開口領域21から出射されてしまう。それ故、従来の液晶パネル1を用いた投射型表示装置では、逆明視方向から入射した光も表示に関与するので、コントラストが低いという問題点がある。

[0011]

以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、逆明視方向に傾いた方向から入射した光が表示に関与することを防止することにより、コントラスト特性を向上することのできる液晶パネル、およびそれをライトバルブとして用いた投射型表示装置を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明では、第1及び第2基板間に液晶が挟持されてなり、前記第1基板に形成された複数の走査線と複数のデータ線と、前記各走査線とデータ線に接続されたスイッチング素子と前記スイッチング素子に接続された画素電極とからなる画素とを有し、前記第1及び第2基板のうちの一方の基板には各画素に対向するように第1マイクロレンズが形成されてなり、前記第1マイクロレンズの光学的中心位置は、該第1マイクロレンズに対向する画素の開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする。

[0013]

本発明に係る液晶パネルにおいて、第1マイクロレンズの光学的中心位置が明視方向の側にずれているので、例えば第2基板の側から入射した光のうち、明視方向に傾いた方向から入射した光は、第1マイクロレンズで屈折しても第1基板の開口領域から出射されるが、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた方向から入射した光は、第1マイクロレンズで屈折した後、第1基板に対しては開口領域からずれた位置に照射され、第1基板から出射されない。従って、第2基板の側から明視方向および逆明視方向に傾いた光が入射しても、逆明視方向に傾いた光は表示に関与しない。それ故、本発明を適用した液晶パネルによれば、コントラストの高い表示を行うことができる。このように第1マイクロレンズの光学的中心位置を画素の開口領域の中心位置に対して明視方向側にずらすことにより、コントラストの高い表示が可能となる。画素の開口領域の中心位置とにより、コントラストの高い表示が可能となる。画素の開口領域の中心位置とは画素の表示に寄与する領域の対角線、あるいは対角線を特定できないような形状の場合は画素の表示に寄与する領域の重心を示す。また、マイクロレンズの光学的中心位置は、マイクロレンズの幾何学的な中心位置ではなく、光軸、即

ち1つのレンズの光学表面の曲率中心を結んだ線を意味する。尚、ここで言う「明視方向側にずらす」ということは単に明視方向にずらすことを意味するだけでなく、基板に対して上下左右のいずれかの明視方向に近い方向にずらすことも含むものとする。例えば、明視方向が1時半の場合のずらす方向は基板に対して上方向あるいは右方向を含み、また明視方向が10時半の場合のずらす方向は基板に対して上方向あるいは左方向を含むものとし、このような方向にずらすことによりコントラストの高い表示を行うことができる。

[0014]

本発明は、前記他方の基板には各画素に対向するようにマイクロレンズが形成されていることを特徴とする。かかる構成によれば、他方の基板にもマイクロレンズが形成されているため、マイクロレンズを介して入射あるいは出射される光を集光あるいは平行光とすることが可能となり、光の利用効率を高めることができる。

[0015]

また、本発明は前記第2マイクロレンズの光学的中心位置は、該第2マイクロレンズに対向する画素の開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする。本発明のかかる構成によれば、一方の基板に形成された第1マイクロレンズに加えて、他方の基板に第2マイクロレンズが形成されているため、例えば第1マイクロレンズを介して入射されたコントラストの高い光を効率よく第2マイクロレンズを介して出射することができ、また平行光、あるいは拡散光とすることにより実質的に画素の開口率を向上させることができる。

[0016]

また、本発明は、第1及び第2基板間に液晶が挟持されてなり、前記第1基板に形成された複数の走査線と複数のデータ線と、前記各走査線とデータ線に接続されたスイッチング素子と前記スイッチング素子に接続された画素電極とからなる画素とを有し、前記第2基板には遮光膜が形成されてなる液晶パネルにおいて、前記第1及び第2基板には画素毎に第1及び第2の開口領域が形成されているとともに、前記第1及び第2開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成された開口領域の中心位置は、光が出射される側の基板に形成された開口領域の中心位置は、光が出射される側の基板に形成された開口領域の中心

位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする。

[0017]

本発明では、たとえば、第2基板に形成されている第2開口領域に入射した光が、第1基板に形成した第1開口領域を透過して表示を行う構成とした場合には、第2開口領域の中心位置は第1開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれていることを特徴とする。このような構成の液晶パネルにおいて、第2基板に形成した第2の開口領域に入射した光のうち、明視方向側に傾いた方向から入射した光は、第1の基板に形成した第1の開口領域から出射されるが、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた方向から入射した光は、第1基板に対して第1開口領域からずれた位置に照射され、第1基板から出射するのを抑える。従って、第2基板の側から明視方向および逆明視方向に傾いた光が入射しても、逆明視方向に傾いた光は表示に関与しない。それ故、本発明を適用した液晶パネルによれば、コントラストの高い表示を行うことができる。

[0018]

本発明は、前記第1基板と第2基板のうちの一方の基板には各画素毎に対向するようにマイクロレンズが形成されてなり、前記マイクロレンズの光学的中心位、置は、該マイクロレンズが形成された基板の開口領域の中心位置にほぼ一致するように配置されていることを特徴とする。

[0019]

かかる構成によれば、第1基板と第2基板のうち光が入射される側の基板に形成された開口領域の中心位置は光が出射される側の基板に形成された開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれている構成に加えて、第1基板と第2基板の一方にマイクロレンズが形成されている。従って、明視方向側にずれた光をマイクロレンズにより集光あるいは平行光にすることが可能となり、よりコントラストの高い表示が可能となる。

[0020]

本発明は、前記第1基板と第2基板のうちの一方の基板には各画素毎に対向するようにマイクロレンズが形成されてなり、前記マイクロレンズの光学的中心位置は、該マイクロレンズが形成された基板の開口領域の中心位置に対して明視方

向側にずれていることを特徴とする。かかる構成によれば、明視方向側にずれた 光がマイクロレンズに入射されるため、逆明視方向側の光の入射を抑えることが できるため、よりコントラストの高い表示を行うことができる。

[0021]

本発明は、第1および第2基板には、隣接する前記画素電極の間の領域と重なるように第1および第2の遮光膜がそれぞれマトリクス状に形成されていることにより、前記第1および第2の開口領域が前記画素毎にマトリクス状に区画形成されていることを特徴とする。

[0022]

かかる構成によれば、前記第1および第2の遮光膜のうち、光が入射する側の基板に形成された遮光膜が、光が出射する側の基板に形成されている開口領域に対して明視方向側と比較して逆明視方向側で幅広に重なっていることにより、前記第1および第2の開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成された開口領域の中心位置が、光が出射する側の基板に形成された開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれている。かかる構成によれば、明視方向から入射される光を透過し、逆明視方向からの光を遮ることができるため、コントラストの高い表示を行うことができる。

[0023]

また、本発明において、前記第1および第2の遮光膜のうち、光が出射する側の基板に形成された遮光膜が、光が入射する側の基板に形成されている開口領域に対して逆明視方向側と比較して明視方向側で幅広に重なっていることにより、前記第1および第2の開口領域のうち、光が入射する側の基板に形成された開口領域の中心位置が、光が出射する側の基板に形成された開口領域の中心位置に対して明視方向側にずれている。かかる構成によれば、明視方向から出射される光を透過し、逆明視方向から出射される光を遮ることができるため、コントラストの高い表示を行うことができる。

[0024]

本発明において、光源からの光は、前記第2基板に入射して前記第1基板から 出射するように構成される。かかる構成によれば、第2基板から入射される光は 明視方向にずらされるため、コントラストの低下の原因となる逆明視方向に傾い た方向から入射される光を抑えることができ、コントラストの高い表示を行うこ とができる。

[0025]

本発明において、前記の各画素では、前記画素スイッチング素子が前記画素電極に対して明視方向側に形成されていることが好ましい。すなわち、第1基板において、開口領域は、基本的には、データ線、走査線および容量線によって区画された領域から画素スイッチング用素子の形成領域を除いた領域として構成されるので、画素スイッチング用素子が形成されている側ではその分だけ、幅広に形成される。このため、画素スイッチング用素子が形成されている側ではその分だけ、光が通らない領域が広いことになるので、画素スイッチング素子が画素電極に対して明視方向側に形成されていれば、逆明視方向に傾いた方向から入射した光を画素スイッチング素子を形成した領域を利用して遮ることができる。また、スイッチング素子に加えて、走査線や容量線も明視方向側に形成すれば、逆明視方向に傾いた方向から入射した光がスイッチング素子、走査線、容量線を形成した領域を利用して遮ることができる。

[0026]

本発明において、前記液晶パネルに入射される光の光軸が前記液晶パネルの法線方向に対して明視方向側に傾いていることが好ましい。かかる構成によれば、明視方向側からの光が基板に入射されるため、よりコントラストを高めることができる。

[0027]

本発明を適用した液晶パネルはコントラスト特性が高いので、投射型表示装置のライトバルブとして用いることが好ましい。すなわち、本発明に係る液晶パネルを用いた投射型表示装置には、光源と、該光源から出射された光を、本発明に係る液晶パネルに導く集光系と、当該液晶パネルで光変調した光を拡大投射する拡大投射光学系とを設ける。

[0028]

本発明の投射型表示装置の液晶パネルは、前記液晶パネルの法線方向に対して

光軸が明視方向側に傾いた光が前記液晶パネルに入射されることが好ましい。かかる構成によれば、明視方向側に傾いた光が基板に入射されるため、よりコントラストを高めることができる。

[0029]

【発明の実施の形態】

図面を参照して、本発明の各実施の形態を説明する。なお、以下に説明する各 実施の形態に係る液晶パネルは、先に説明した従来の液晶パネルと基本的な構成 が同一なので、共通する機能を有する部分には同じ符号を付して説明する。また 、以下に各実施の形態を説明するが、各形態において共通する構成について先に 説明しておく。

[0030]

[液晶パネルの全体構成]

図1および図2はそれぞれ、本形態に係る液晶パネル1を対向基板の側からみた平面図、および図1のH-H'線で切断したときの液晶パネル1の断面図である。

[0031]

図1および図2において、液晶パネル1は、画素電極8がマトリクス状に形成されたアクティブマトリクス基板20と、対向電極32が形成された対向基板30と、これらの基板20、30間に封入、挟持されている液晶39とから概略構成されている。アクティブマトリクス基板20と対向基板30とは、対向基板30の外周縁に沿って形成されたギャップ材含有のシール材52によって所定の間隙を介して貼り合わされている。また、アクティブマトリクス基板20と対向基板30との間には、ギャップ材含有のシール材52によって液晶封入領域40が区画形成され、この内側に液晶39が封入されている。シール材52としては、エポキシ樹脂や各種の紫外線硬化樹脂などを用いることができる。また、ギャップ材としては、約2μm~約10μmの無機あるいは有機質のファイバ若しくは球を用いることができる。

[0032]

対向基板30はアクティブマトリクス基板20よりも小さく、アクティブマト

リクス基板20の周辺部分は、対向基板30の外周縁よりはみ出た状態に貼り合わされる。従って、アクティブマトリクス基板20の駆動回路(走査線駆動回路70やデータ線駆動回路60)や入出力端子45は対向基板30から露出した状態にある。ここで、シール材52は部分的に途切れて液晶注入口241が構成されている。対向基板30とアクティブマトリクス基板20とを貼り合わせた後、液晶注入口241から液晶39を液晶39を封入した後、液晶注入口241を封止剤242で塞ぐ。尚、対向基板30には、シール材52の内側において画像表示領域4を見切りするための表示見切り用の遮光膜55も形成されている。また、対向基板30のコーナー部のいずれにも、アクティブマトリクス基板20と対向基板30との間で電気的導通をとるための上下導通材56が形成されている。

[0033]

[アクティブマトリクス基板の構成]

図3は、液晶パネル1の構成を模式的に示すブロック図、図4は、この液晶パネル1に用いたアクティブマトリクス基板の画素領域の一部を抜き出して示す平面図、図5は、図4におけるA-A'線におけるアクティブマトリクス基板の断面図(遮光膜の図示を省略してある。)である。

[0034]

図3において、本実施の形態による液晶装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素は、画素電極8及び画素電極8を制御するためのTFT10とからなり、画像信号が供給されるデータ線90が当該TFT10のソースに電気的接続されている。データ線90に書き込む画像信号S1、S2、…、Snが順次供給される。また、TFT10の走査線91を介してゲート電極にはパルス的に走査信号G1、G2、…、Gmが、この順に線順次で印加するように構成されている。画素電極9は、TFT10のドレインに電気的接続されており、TFT10を一定期間だけそのスイッチを閉じることにより、データ線90から供給される画像信号S1、S2、…、Snを所定のタイミングで書き込む。画素電極8を介して液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号S1、S2、…、Snは、対向基板(後述する)に形成された対向電極(後述する)との間で一定期間保持される。ここで、保持された画像信号がリークするのを防ぐために、

画素電極 8 と対向電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量 4 0 を付加する。尚、このように蓄積容量 4 0 を形成する方法としては、容量を形成するための配線である容量線 9 2 を設けても良いし、前段の走査線 9 1 との間で容量を形成しても良い。

[0035]

図4に示すように、いずれの画素においても、複数の透明な画素電極8がマトリクス状に形成されており、画素電極9の縦横の境界に沿って、データ線90、走査線91および容量線92が形成されている。データ線90は、ポリシリコン膜等の半導体層のうち、ソース領域16にコンタクトホールを介して電気的に接続し、画素電極8は、ドレイン領域17にコンタクトホールを介して電気的に接続している。また、チャネル領域15に対向するように走査線91が延びている。なお、蓄積容量40は、画素スイッチング用のTFT10を形成するためのシリコン膜10a(半導体膜/図4に斜線を付した領域)の延設部分に相当するシリコン膜40a(半導体膜/図4に斜線を付した領域)を導電化したものを下電極41とし、この下電極41に対して容量線92が上電極として重なった構造になっている。

[0036]

このように構成した画素領域のA-A'線における断面は、基本的には図5に示すように表される。まず、アクティブマトリクス基板2の表面には下地絶縁膜201の上に島状のシリコン膜10a、40aが形成されている。また、シリコン膜10aの表面にはゲート絶縁膜13が形成され、このゲート絶縁膜13の上に走査線91(ゲート電極)が形成されている。シリコン膜10aのうち、走査線91に対してゲート絶縁膜13を介して対峙する領域がチャネル領域15になっている。このチャネル領域15に対して一方側には、低濃度ソース領域161および高濃度ソース領域162を備えるソース領域16が形成され、他方側には低濃度ドレイン領域171および高濃度ドレイン領域172を備えるドレイン領域17が形成されている。このように構成された画素スイッチング用のTFT10の表面側には、第1層間絶縁膜18および第2層間絶縁膜19が形成され、第1層間絶縁膜18の表面に形成されたデータ線90は、第1層間絶縁膜18に形

成されたコンタクトホールを介して高濃度ソース領域162に電気的に接続している。また、画素電極8は、第1層間絶縁膜18および第2層間絶縁膜19に形成されたコンタクトホールを介して高濃度ドレイン領域162に電気的に接続している。また、高濃度ドレイン領域172から延設されたシリコン膜40aには低濃度領域からなる下電極41が形成され、この下電極41に対しては、ゲート絶縁膜13と同時形成された絶縁膜(誘電体膜)を介して容量線92が対向している。このようにして蓄積容量40が形成されている。

[0037]

ここで、TFT10は、好ましくは上述のようにLDD構造をもつが、オフセット構造であってもよいし、走査線91をマスクとして高濃度で不純物イオンを打ち込み自己整合的に高濃度ソースおよびドレイン領域を形成したセルフアライン型のTFTであってもよい。

[0038]

[実施の形態1]

図6は、本発明の実施の形態1に係る液晶パネル1に用いたアクティブマトリクス基板、対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。図7および図8はそれぞれ、この液晶パネル1の対向基板30に形成したマイクロレンズと、アクティブマトリクス基板20に形成した画素電極8との位置関係を示す平面図および説明図である。なお、図6に示す断面は、図7および図8のB-B'線における断面に相当する。

[0039]

図6において、本形態の液晶パネル1では、アクティブマトリクス基板20上には、下地保護膜201の下層側にクロムなどの金属膜からなる第1の遮光膜6が形成され、この第1の遮光膜6は、図7に左下がりの斜線領域として示すように、隣接する画素電極8の間に相当する領域にマトリクス状に形成されている。このため、第1の遮光膜6は、図4および図5を参照して説明したデータ線90、走査線91、容量線92、TFT10および蓄積容量40と平面的に重なる領域に形成され、かつ、この第1の遮光膜6によってアクティブマトリクス基板20の各画素には第1の開口領域21がマトリクス状に区画形成されている。

[0040]

また、対向基板30の側には、図7に右下がりの斜線領域として示すように、アクティブマトリクス基板20の第1の遮光膜6と対向するように第2の遮光膜7がマトリクス状に形成され、この第2の遮光膜7によって第2の開口領域31がマトリクス状に区画形成されている。また、対向基板30には、アクティブマトリクス基板20の画素電極8と対向するようにマイクロレンズ41(微少レンズ)がマトリクス状に形成されている。このような構造の対向基板30は、たとえば、マイクロレンズ41が形成されたレンズアレイ基板40に対して接着剤48によって薄板ガラス49を貼り合わせ、この薄板ガラス49に対して第2の遮光膜7、透明な対向電極32、および配向膜47を形成することにより製造できる。

[0041]

このように構成した対向基板30およびアクティブマトリクス基板20については、それぞれ互いに直交する方向にラビング処理が施された後、所定の隙間を介して貼り合わされ、しかる後に、この隙間内に液晶39が封入される。その結果、液晶39は、アクティブマトリクス基板20と対向基板30との間で90°に捩じれ配向した状態になる。従って、液晶パネル1には、液晶39の配向状態に対応して明視方向および逆明視方向が生じ、逆明視方向に傾いた方向から液晶パネル1に入射した光が表示に関与すると、コントラストを低下させる。ここに示す例では、各画素において、画素電極8に対して画素スイッチング用のTFT10が位置する方(図面下側)明視方向になっており、それとは反対側(図面上側)が逆明視方向になっている。

[0042]

そこで、本形態では、図6、図7および図8に示すように、対向基板30に形成したマイクロレンズ41の焦点位置411をアクティブマトリクス基板20の第1の開口領域21の中心位置に対して、明視方向側にずらしてある。

[0043]

このため、本形態の液晶パネル1においては、図6および図8に示すように、 対向基板30の側から入射した光のうち、明視方向側に傾いた方向から入射した 光は、マイクロレンズ41で屈折してもアクティブマトリクス基板20の第1の開口領域21から出射され、表示に関与する。これに対して、逆明視方向側に傾いた方向から対向基板30に入射した光は、マイクロレンズ41で屈折した後、アクティブマトリクス基板20に対しては第1の開口領域21からずれた位置に照射され、各画素において明視方向側に位置する第1の遮光膜6によって遮られるので、アクティブマトリクス基板20から出射されるのを抑えることができる。それ故、対向基板30側から入射する光に明視方向および逆明視方向に傾いた光が含まれていたとしても、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた光は、アクティブマトリクス基板20から出射されるのを抑えることができるので、表示に関与しない。よって、本発明を適用した液晶パネル1によれば、コントラストの高い表示を行うことができる。

[0044]

また、本形態の液晶パネル1では、各画素において、画素スイッチング用のT FT10が画素電極8に対して明視方向側に形成されているので、逆明視方向に 傾いた方向から入射した光を効果的に遮ることができる。すなわち、アクティブ マトリクス基板20において、第1の開口領域21は、基本的には、データ線9 0、走査線91および容量線92によって矩形に区画された領域から画素スイッ チング用のTFT10および蓄積容量40の形成領域を除いた領域として構成さ れるので、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側ではその分だけ 、第1の遮光膜6が張り出している。このため、画素スイッチング用のTFT1 0が形成されている側ではその分だけ、光が通らない領域が広いことになるので 、逆明視方向に傾いた方向から入射した光を画素スイッチング用のTFT10を 形成した領域を利用して遮ることができる。本実施形態では、対向基板30側に マイクロレンズを形成する場合を説明したが、アクティブマトリクス基板20の 各画素に対応してマイクロレンズを設けてもよい。また、対向基板30とアクテ ィブマトリクス基板20の両方にマイクロレンズを設けても良い。その場合、ア クティブマトリクス基板20に形成するマイクロレンズは液晶パネルに明視方向 側から傾いて入射された光を平行光、あるいは拡散光とすることが可能となるた め、画素の光の開口率を実質的に高めることができる。また用途に応じて拡大さ

せたり、収束させたりしてもかまわない。また、対向基板30に形成するマイクロレンズの光学的中心位置を明視方向側にずらし、さらにアクティブマトリクス基板に形成するマイクロレンズの光学的中心位置を明視方向側にずらし、互いの焦点位置を一致させるようにすれば、光の利用効率を高めることができる。

[0045]

[実施の形態2]

図9は、本発明の実施の形態2に係る液晶パネル1に用いたアクティブマトリクス基板、対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。図10および図11はそれぞれ、液晶パネル1のアクティブマトリクス基板20に形成した第1の遮光膜6と、対向基板30に形成した第2の遮光膜7との位置関係を示す平面図および説明図である。なお、図9に示す断面は、図10および図11のB-B/線における断面に相当する。

[0046]

図9において、実施形態1と同様な構成を有し、異なる点について詳述する。本実施形態においても下地保護膜201の下層側に第1の遮光膜6が形成され、この第1の遮光膜6は、図10に左下がりの斜線領域として示すように、隣接する画素電極8の間に相当する領域にマトリクス状に形成されている。このため、第1の遮光膜6は、図4を参照して説明したデータ線90、走査線91、容量線92、TFT10および蓄積容量40と平面的に重なる領域に形成され、かつ、この第1の遮光膜6によってアクティブマトリクス基板20の各画素には第1の開口領域21が区画形成されている。

[0047]

また、対向基板30の側には、アクティブマトリクス基板20の第1の遮光膜6と対向するように第2の遮光膜7がマトリクス状に形成され、この第2の遮光膜7によって第2の開口領域31が形成されている。この第2の遮光膜7の形成領域は、図10に右下がりの斜線領域として示してある。さらに、対向基板30の側には、対向電極32および配向膜47が形成されている。

[0048]

このように構成した対向基板30およびアクティブマトリクス基板20につい

ても、液晶39は実施の形態1と同様に捩じれ配向した状態になる。従って、液晶パネル1には、液晶39の配向状態に対応して明視方向および逆明視方向が生じ、逆明視方向に傾いた方向から液晶パネル1に入射した光が表示に関与すると、コントラストを低下させる。ここに示す例においても、各画素において、画素電極8に対して画素スイッチング用のTFT10が位置する方(図面下側)が明視方向になっており、それとは反対側が逆明視方向になっている。

[0049]

そこで、本形態では、蓄積容量9、図10および図11に示すように、第1および第2の遮光膜6、7のうち、光が入射する対向基板30の側に形成されている第2の遮光膜7が、光が出射するアクティブマトリクス基板20の側に形成されている第1の開口領域21に対して明視方向側と比較して逆明視方向側で幅広に重なるように形成されている。このため、対向基板30の側に形成された第2の開口領域31の中心位置311は、アクティブマトリクス基板20の側に形成された第1の開口領域21の中心位置211に対して明視方向側にずれている。すなわち、各画素において、第2の遮光膜7の縁は、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側(明視方向の側)では第1の遮光膜6の縁と略重なっているので、第2の遮光膜7と第1の開口領域21とは明視方向の側でほとんど重なっていないが、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側と反対側(逆明視方向の側)において、第2の遮光膜7の縁は、第1の遮光膜6の縁よりも第1の開口領域21の方に幅Lに相当する分だけ、張り出している。また、容量線と走査線も明視方向側に形成されている。

[0050]

このため、本形態の液晶パネル1においては、図9および図11に示すように、対向基板30の側から入射した光のうち、明視方向に傾いた方向から入射した光はアクティブマトリクス基板20の第1の開口領域21から出射され、表示に関与するが、逆明視方向に傾いた方向から対向基板30に入射した光は、アクティブマトリクス基板20に対して第1の開口領域21からずれた位置に照射され、各画素において明視方向に位置する部分の第1の遮光膜6によって遮られるので、アクティブマトリクス基板20から出射されるのを防ぐことができる。それ

故、対向基板30側から入射する光に明視方向および逆明視方向に傾いた光が含まれていたとしても、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた光は、アクティブマトリクス基板20から出射されれるのを抑えることができるので、表示に関与しない。よって、本発明を適用した液晶パネル1によれば、コントラストの高い表示を行うことができる。

[0051]

また、本形態の液晶パネル1でも、各画素において、画素スイッチング用のT FT10が画素電極8に対して明視方向側に形成されているので、逆明視方向に 傾いた方向から入射した光を効果的に遮ることができる。すなわち、アクティブ マトリクス基板20において、第1の開口領域21は、基本的には、データ線9 0、走査線91および容量線92によって矩形に区画された領域から画素スイッ チング用のTFT10および蓄積容量40の形成領域を除いた領域として構成さ れるので、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側ではその分だけ 、第1の遮光膜6が張り出している。このため、画素スイッチング用のTFT1 〇が形成されている側ではその分だけ、光が通らない領域が広いことになるので 、逆明視方向に傾いた方向から入射した光を画素スイッチング用のTFT10を 形成した領域を利用して遮ることができる。尚、本実施形態において、実施の形 態1と同様に対向基板30にマイクロレンズ41を設けてもよい。その場合、マ イクロレンズ41の焦点位置を対向基板30の開口領域21の中心位置211に 一致するように形成することにより、光の利用効率が高められるためコントラス トの良い表示が可能となる。さらに、マイクロレンズ41の焦点位置を明視方向 側にずらし、好ましくは開口領域31の中心位置311にほぼ一致するようにす れば、コントラストの良い表示を行うことができるとともに、逆明視方向側から の光の入射を防ぐために効果的である。

[0052]

[実施の形態3]

なお、対向基板30の側に形成された第2の開口領域31の中心位置311を 、アクティブマトリクス基板20の側に形成された第1の開口領域21の中心位 置211に対して明視方向側にずらずにあたっては、実施の形態2のように、対 向基板30の側に形成されている第2の遮光膜7が、アクティブマトリクス基板20の側に形成されている第1の開口領域21に対して明視方向側と比較して逆明視方向側で幅広に重なっている構成の他、アクティブマトリクス基板20の側に形成されている第1の遮光膜6が、対向基板30の側に形成されている第2の開口領域31に対して逆明視方向側と比較して明視方向側で幅広に重なっている構成、あるいは、以下に説明する実施の形態3のように、これらの構成を組み合わせた構成であってもよい。

[0053]

図12は、本発明の実施の形態3に係る液晶パネル1に用いたアクティブマトリクス基板、対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。図13および図14はそれぞれ、液晶パネル1のアクティブマトリクス基板20に形成した第1の遮光膜6と、対向基板30に形成した第2の遮光膜7との位置関係を示す平面図および説明図である。なお、図12に示す断面は、図13および図14のB-B/線における断面に相当する。

[0054]

図12において、実施の形態1と同様な構成を有し、異なる点のみ詳述する。本実施の形態では、下地保護膜201の下層側に第1の遮光膜6が形成され、この第1の遮光膜6は、図13に左下がりの斜線領域として示すように、隣接する画素電極8の間に相当する領域にマトリクス状に形成されている。このため、第1の遮光膜6は、図4を参照して説明したデータ線90、走査線91、容量線92、TFT10および蓄積容量40と平面的に重なる領域に形成され、かつ、この第1の遮光膜6によってアクティブマトリクス基板20の各画素には第1の開口領域21が区画形成されている。

[0055]

また、対向基板30の側には、アクティブマトリクス基板20の第1の遮光膜6と対向するように第2の遮光膜7がマトリクス状に形成され、この第2の遮光膜7によって第2の開口領域31が形成されている。この第2の遮光膜7の形成領域は、図13に右下がりの斜線領域として示してある。さらに、対向基板30の側には、対向電極32および配向膜47が形成されている。

[0056]

このように構成した対向基板30およびアクティブマトリクス基板20間において、液晶39は実施の形態1と同様に配向した状態になる。従って、液晶パネル1には、液晶39の配向状態に対応して明視方向および逆明視方向が生じ、逆明視方向に傾いた方向から液晶パネル1に入射した光が表示に関与すると、コントラストを低下させる。ここに示す例においても、各画素において、画素電極8に対して画素スイッチング用のTFT10が位置する方が明視方向になっており、それとは反対側が逆明視方向になっている。

[0057]

そこで、本形態では、まず、実施の形態2と同様、各画素において、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側と反対側(逆明視方向の側)では、対向基板30に形成されている第2の遮光膜7の縁が、第1の遮光膜6の縁よりも画素内側に向かって幅L1に相当する分だけ、張り出している。このため、対向基板30の側に形成されている第2の遮光膜7は、光が出射するアクティブマトリクス基板20の側に形成されている第1の開口領域21に対して明視方向側と比較して逆明視方向側で幅広に重なっている。

[0058]

また、本形態では、各画素において、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側では、アクティブマトリクス基板20に形成されている第1の遮光膜6の縁が、第2の遮光膜7の縁よりも画素内側に向かって幅L2に相当する分だけ、張り出している。このため、アクティブマトリクス基板20の側に形成されている第1の遮光膜6は、対向基板30の側に形成されている第2の開口領域31に対して逆明視方向側と比較して明視方向側で幅広に重なっている。

[0059]

従って、本形態の液晶パネル1において、第1および第2の開口領域21、3 1のうち、光が入射する対向基板30の側に形成された第2の開口領域31の中心位置311は、光が出射するアクティブマトリクス基板20の側に形成された第1の開口領域21の中心位置211に対して明視方向側にずれている。

[0060]

このため、本形態の液晶パネル1においては、図12および図14に示すように、対向基板30の側から入射した光のうち、明視方向に傾いた方向から入射した光はアクティブマトリクス基板20の第1の開口領域21から出射され、表示に関与するが、逆明視方向に傾いた方向から対向基板30に入射した光は、アクティブマトリクス基板20に対して第1の開口領域21からずれた位置に照射され、各画素において明視方向に位置する部分の第1の遮光膜6によって遮られるので、アクティブマトリクス基板20から出射されない。それ故、対向基板30側から入射する光に明視方向および逆明視方向に傾いた光が含まれていたとしても、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた光は、アクティブマトリクス基板20から出射されないので、表示に関与しない。よって、本発明を適用した液晶パネル1によれば、コントラストの高い表示を行うことができる

[0061]

また、本形態の液晶パネル1でも、各画素において、画素スイッチング用のTFT10が画素電極8に対して明視方向側に形成されているので、逆明視方向に傾いた方向から入射した光を効果的に遮ることができる。すなわち、アクティブマトリクス基板20において、第1の開口領域21は、基本的には、データ線90、走査線91および容量線92によって矩形に区画された領域から画素スイッチング用のTFT10および蓄積容量40の形成領域を除いた領域として構成されるので、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側ではその分だけ、第1の遮光膜6が張り出している。このため、画素スイッチング用のTFT10が形成されている側ではその分だけ、光が通らない領域が広いことになるので、逆明視方向に傾いた方向から入射した光を画素スイッチング用のTFT10を形成した領域を利用して遮ることができる。

[0062]

尚、上述の実施形態を組み合わせて構成すればよりコントラストのよい表示が 可能となる。また、上述の実施形態は、6時明視の場合を例として説明したが、 これに限るものではない。また、例えば1時半明視、あるいは10時半明視とい うように基板の斜め方向に明視方向がある場合には、画素の開口率の中心位置あるいはマイクロレンズの光学的中心位置を明視方向にずらすことによりコントラストを向上させることができるが、上下左右の明視方向に近い側にずらすことによってもコントラストを向上させることができる。また、液晶パネルに光が入射される際に、液晶パネルの法線に対して光軸が明視方向側に傾いた光を液晶パネルに入射するようにすれば、逆明視方向側からの光の入射を防ぐために効果的となりさらにコントラストの高い表示が可能となる。

[0063]

また、上述の実施の形態では、アクティブマトリクス基板の第1の遮光膜6は TFTの下層に形成されているが、これに限るものではなく、例えば、TFTの 上層あるいは遮光性を有する配線で第1遮光膜6と同様にアクティブマトリクス 基板に形成しても良い。

[0064]

[液晶パネル1の電子機器への適用]

次に、本形態の液晶パネル1を備えた電子機器の一例を、図15および図16を参照して説明する。図15は、電子機器のブロック図であり、図15に示す表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、表示駆動回路1004、液晶パネルなどの表示パネル1006、クロック発生回路1008及び電源回路1010を含んで構成される。表示情報出力源1000は、ROM、RAMなどのメモリ、テレビ信号を同調して出力する同調回路などを含んで構成され、クロック発生回路1008からのクロックに基づいて、ビデオ信号などの表示情報を出力する。表示情報処理回路1002は、クロック発生回路1008からのクロックに基づいて表示情報を処理して出力する。この表示情報処理回路1002は、例えば増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路あるいはクランプ回路等を含むことができる。表示駆動回路1004は、走査側駆動回路及びデータ側駆動回路を含んで構成され、液晶パネル1006を表示駆動する。電源回路1010は、上述の各回路に電力を供給する。

[0065]

このような構成の電子機器の一例として、投射型表示装置装置を図16を用い

て説明する。図16に示されるように投射型表示装置1100は、上述した駆動回路1004がTFTアレイ基板上に搭載された液晶装置100を含む液晶表示モジュールを3個用意し、各々RGB用のライトバルブ100R、100G及び100Bとして用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ100では、メタルハライドランプ等の白色光源のランプユニット1102から投射光が発せられると、3枚のミラー1106及び2枚のダイクロイックミラー1108によって、RGBの3原色に対応する光成分R、G、Bに分けられ、各色に対応するライトバルブ100R、100G及び100Bに各々導かれる。この際特にB光は、長い光路による光損失を防ぐために、入射レンズ1122、リレーレンズ1123及び出射レンズ1124からなるリレーレンズ系1121を介して導かれる。そして、ライトバルブ100R、100G及び100Bにより各々変調された3原色に対応する光成分は、ダイクロイックプリズム1112により再度合成された後、投射レンズ1114を介してスクリーン1120にカラー画像として投射される。

[0066]

【発明の効果】

以上のとおり、本発明に係る液晶パネルでは、明視方向および逆明視方向に傾いた方向から入射した光のうち、逆明視方向に傾いた方向から入射した光は液晶パネルから出射されないので、表示に関与しない。従って、本発明を適用した液晶パネルによれば、コントラストの高い表示を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

液晶パネルを対向基板の側からみた平面図である。

【図2】

図1のH-H′線で切断したときの液晶パネルの断面図である。

【図3】

図1に示す液晶パネルの構成を模式的に示すブロック図である。

【図4】

図1に示す液晶パネルの画素領域の一部を抜き出して示す平面図である。

【図5】

図4におけるA-A'線におけるアクティブマトリクス基板の断面図である。 【図6】

本発明の実施の形態1に係る液晶パネルにおけるアクティブマトリクス基板、 対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。

【図7】

図6に示す液晶パネルの対向基板に形成したマイクロレンズと、アクティブマトリクス基板に形成した画素電極との位置関係を示す平面図である。

【図8】

図6に示す液晶パネルの対向基板に形成したマイクロレンズと、アクティブマトリクス基板に形成した画素電極との位置関係を示す説明図である。

【図9】

本発明の実施の形態2に係る液晶パネルにおけるアクティブマトリクス基板、 対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。

【図10】

図9に示す液晶パネルのアクティブマトリクス基板および対向基板のそれぞれ に形成した第1および第2の遮光膜の位置関係を示す平面図である。

【図11】

図9に示す液晶パネルのアクティブマトリクス基板および対向基板のそれぞれ に形成した第1および第2の遮光膜の位置関係を示す説明図である。

【図12】

本発明の実施の形態3に係る液晶パネルにおけるアクティブマトリクス基板、 対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。

【図13】

図12に示す液晶パネルのアクティブマトリクス基板および対向基板のそれぞれに形成した第1および第2の遮光膜の位置関係を示す平面図である。

【図14】

図12に示す液晶パネルのアクティブマトリクス基板および対向基板のそれぞれに形成した第1および第2の遮光膜の位置関係を示す説明図である。

【図15】

本発明を適用した液晶パネルの使用例を示す表示装置の回路構成を示すブロック図である。

【図16】

本発明を適用した液晶パネルの使用例を示す投射型表示装置の全体構成図である。

【図17】

従来の液晶パネルに用いたアクティブマトリクス基板、対向基板およびこれらの基板の貼り合わせ構造を拡大して示す断面図である。

【図18】

液晶パネルにおいて基板間で液晶の長軸方向が90° 捩じれていく様子を示す 説明図である。

【図19】

(A)、(B)はそれぞれ、液晶パネルの3時-9時方向におけるコントラスト変化を示すグラフ、および液晶パネルの6時-12時方向におけるコントラスト変化を示すグラフである。

【図20】

液晶パネルに斜め方向から光が入射する様子を示す説明図である。

【符号の説明】

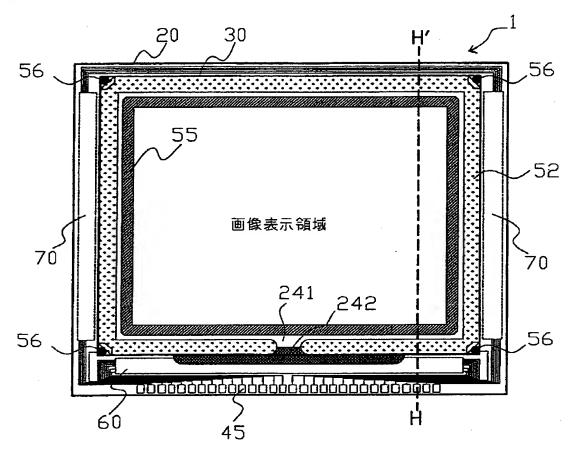
- 1 液晶パネル1
- 4 画像表示領域
- 6 アクティブマトリクス基板側の第1の遮光膜
- 7 対向基板側の第2の遮光膜
- 8 画素電極
- 10 画素スイッチング用のTFT
- 20 アクティブマトリクス基板
- 21 アクティブマトリクス基板側の第1の開口領域
- 30 対向基板
- 31 対向基板側の第2の開口領域

特平10-339606

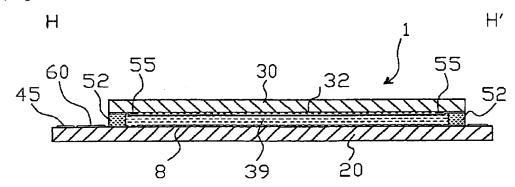
- 32 対向電極
- 39 液晶
- 40 レンズアレイ基板
- 41 マイクロレンズ
- 52 シール材
- 81 画素電極の中心位置
- 90 データ線
- 91 走査線
- 211 第1の開口領域の中心位置
- 311 第2の開口領域の中心位置
- 411 マイクロレンズの光学的中心位置

【書類名】 図面

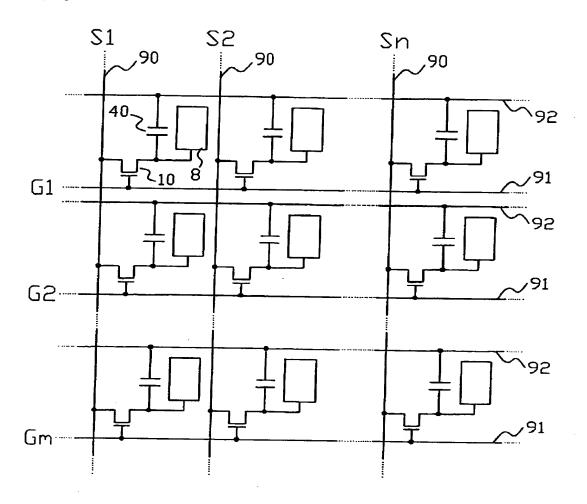
【図1】



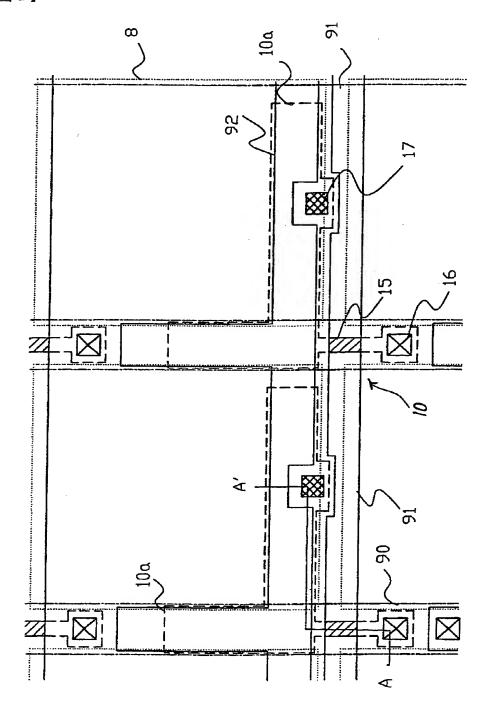
【図2】



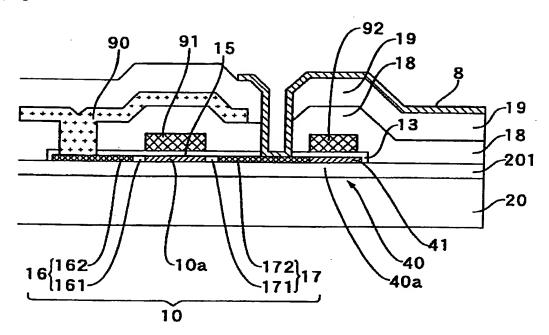
【図3】



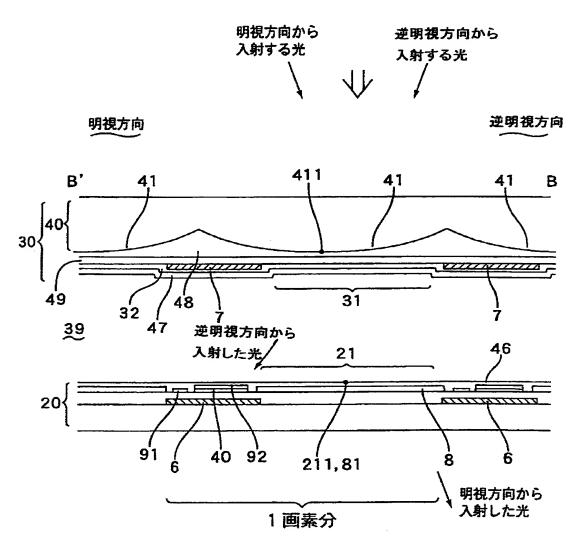
【図4】



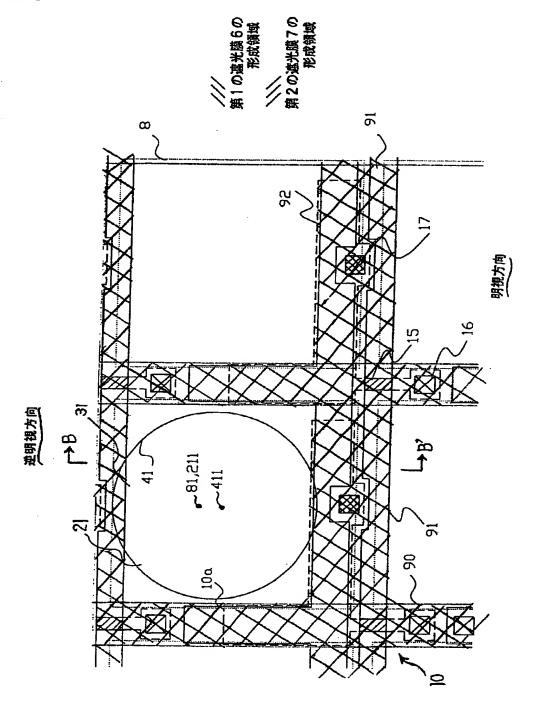
【図5】



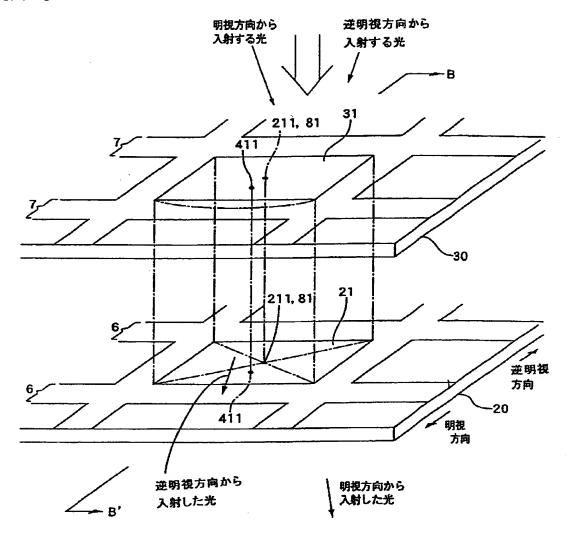
【図6】



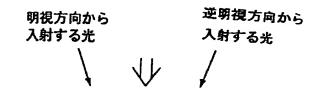
【図7】

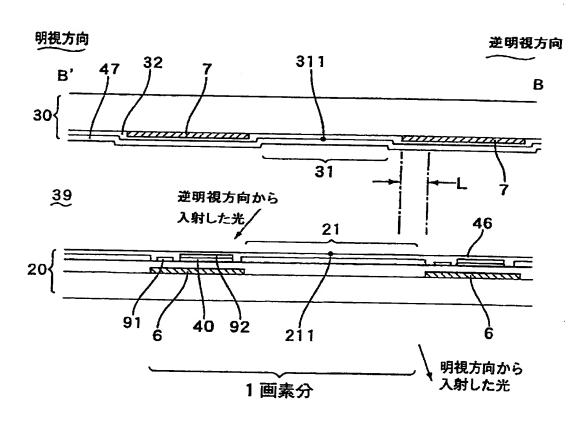


【図8】

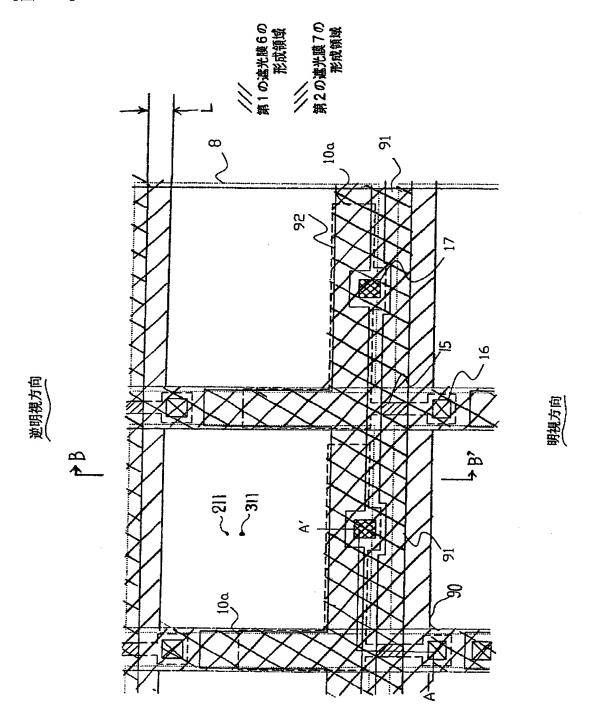


【図9】



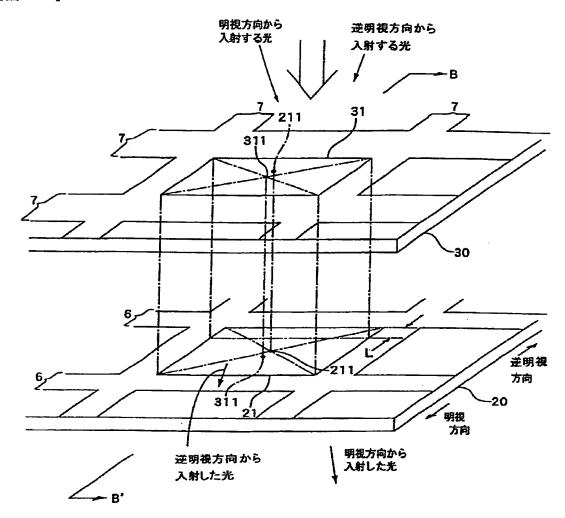


【図10】

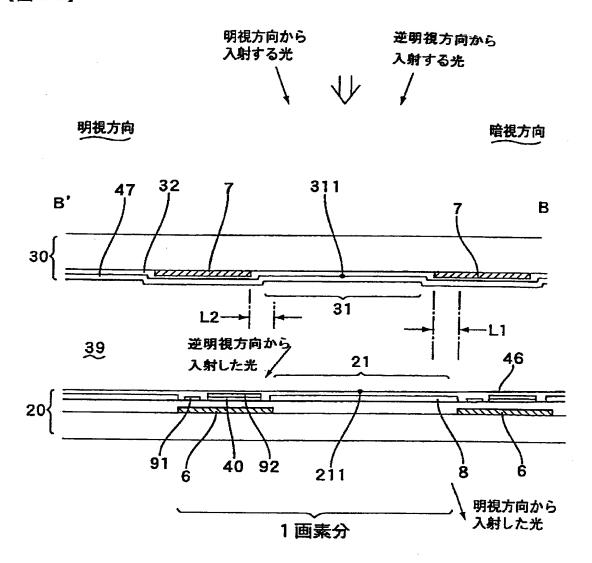


出証特平11-3091514

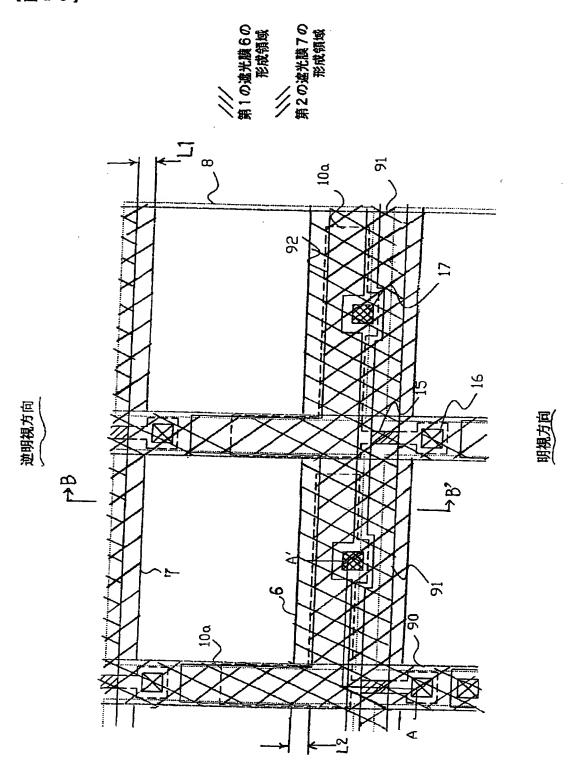
【図11】



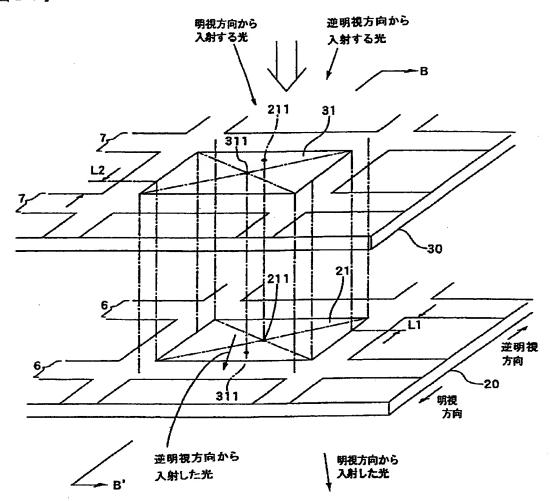
【図12】



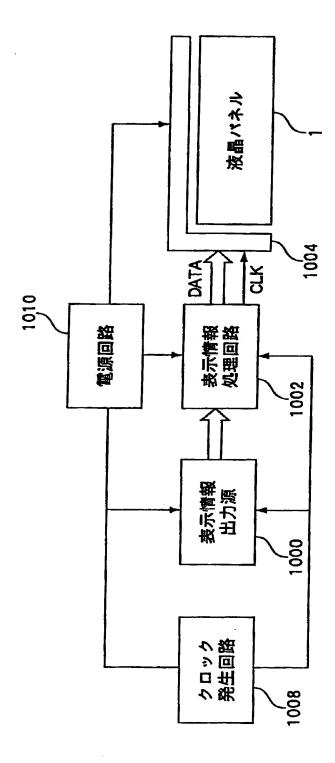
【図13】

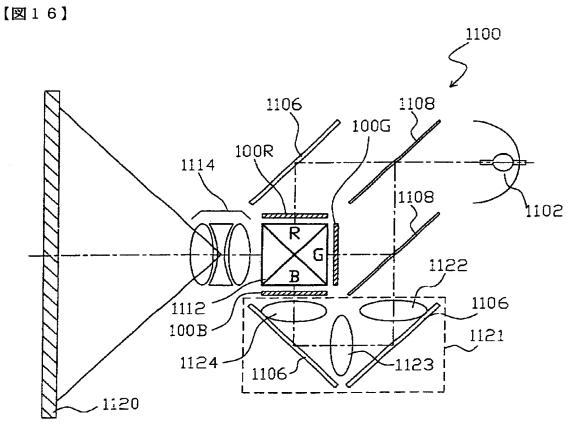


【図14】

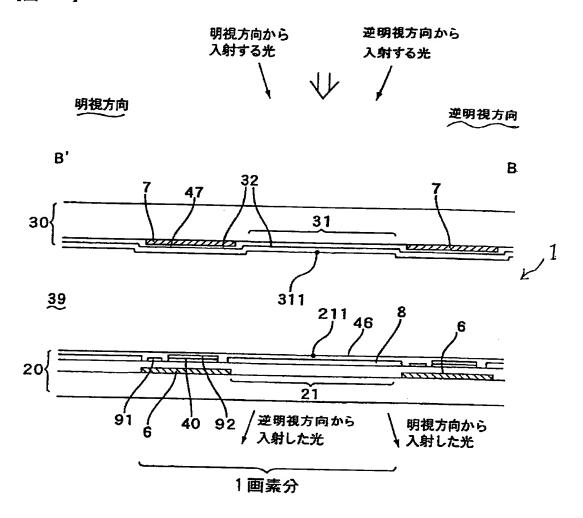


【図15】

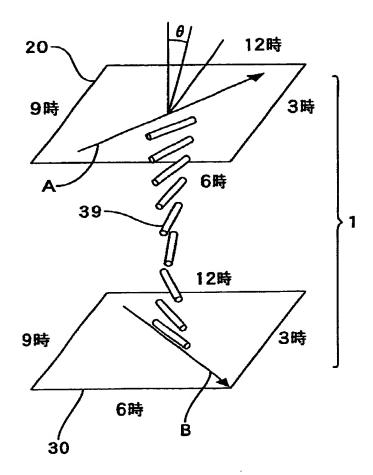




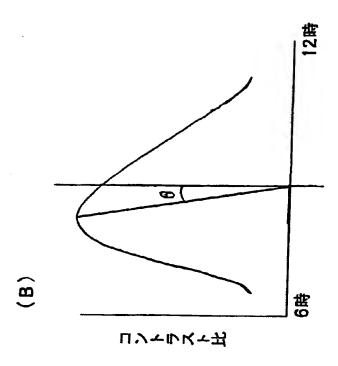
【図17】



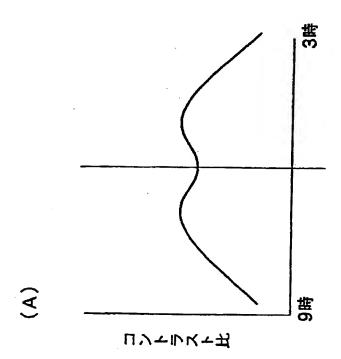
【図18】



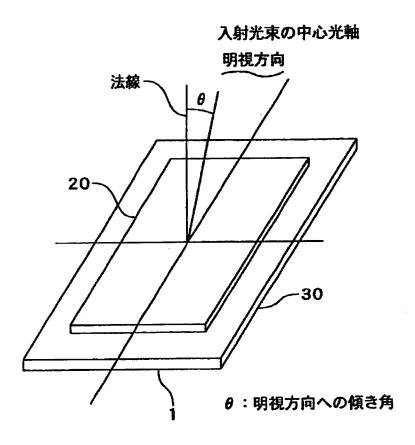
【図19】



8:明視方向への傾き角



【図20】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の課題は、逆明視方向に傾いた方向から入射した光が表示に関与することを防止することにより、コントラスト特性を向上することのできる液晶パネル、およびそれをライトバルブとして用いた投射型表示装置を提供すること。

【解決手段】 液晶パネル1において、対向基板30に形成されているマイクロレンズ41の焦点位置411は、アクティブマトリクス基板20の側において各画素毎に形成されている第1の開口領域21の中心位置211 (画素電極8の中心位置81)からみると、明視方向にずれている。このため、明視方向に傾いた方向から対向基板30に入射した光はアクティブマトリクス基板20から出射されるが、コントラストを低下させる原因となる逆明視方向に傾いた方向から入射した光は、アクティブマトリクス基板20から出射されず、表示に関与しない。

【選択図】 図6

特平10-339606

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100093388

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソ

ン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

鈴木 喜三郎

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソ

ン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソ

ン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

須澤 修



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)